プラズマ計測用ミラー材の光学的性質変化の基礎機構解明と材料創製

九大・応力研 徳永和俊、藤原 正、吉田直亮、九大・総理工 蛯原彩乃、核融合研 時谷政行 東北大・金研 永田晋二、土屋 文

1. はじめに

核融合炉開発において、プラズマ性能を正確に把握するための手段としてレーザーなどを用いた光学的プラ ズマ計測診断法が確立されている。これらは国際熱核融合実験炉(ITER)においても実施される予定である。 このような計測系では鏡面研磨された金属製のミラーが、レーザー反射板として使用されている。しかしなが ら、プラズマに面する位置で使用される第一ミラーはプラズマからの水素同位体やヘリウム等の粒子に曝露さ れることで損傷を受け、光の反射率が低下することが知られている。光反射率に対する水素照射の影響につい ては既に多くの報告があるが、ヘリウム照射の影響についてはこれまで殆ど注目されていない。ヘリウムは材 料中の欠陥との相互作用が極めて強く、材料の損耗・劣化を引き起こすことがこれまでの基礎研究から分かっ ており、プラズマ診断においても重要な問題として提起される。

そこで本研究では、ミラー材として有力視されている Mo 及び W を用い、プラズマ実機環境を考慮した水 素及びヘリウムイオン照射実験を行った。その後、イオン照射されたことによる光学的性質の変化を調べるこ とを目的として、分光光度計や分光エリプソメーターを用いて反射率及び光学定数を測定した。さらに、電子 顕微鏡を用いた表面形状・内部組織観察や TDS 実験を相補的に行うことでプラズマ診断用ミラー材の光学的 性質変化に関する詳細な知見を得ることとした。また、タンデム加速器を用いた弾性反跳粒子検出法(ERD) により、注入水素及びヘリウムの定量分析を進めている。

2. 研究経過

本研究では、Moの場合、多結晶 Mo (10x10mm)を試料として用い、機械研磨後、電解研磨による鏡面研磨 処理を行った。その試料に対して低エネルギーイオン注入装置を用いてヘリウムイオンを照射した。照射イオ ンエネルギーは 8.0keV と 1.2keV とし、双方のエネルギーにおいて室温と 873K で 1x10²² He/m²までの照射 を行った。また、8.0keV・He⁺においては 573K でも同様に 3x10²² He/m²までの照射を行った. さらに,イオ ン種の違いによる変化をみるために 8.0keV の H₂+を室温で 3x10²² H⁺/m²照射した。光反射率の測定は分光光 度計、光学定数の測定は分光エリプソメーターを用いて行っ。また、照射による表面変質および内部損傷は走 査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いてそれぞれ観察した。

3. 研究成果

図 1 に 8.0keV·He⁺、1.2keV·He⁺、8.0keV·H₂⁺照射後の Mo に対する光反射率変化の波長依存性を 200~900nm の波長範囲において測定した結果を示す。これより、He⁺照射においては 8.0keV、1.2keV 双方のイオンエネルギーにおいて、反射率の著しい低下が確認された。一方,H⁺照射においては He⁺の ときほどの反射率低下は確認されなかった.H⁺照射の場合には、スパッタ効率が低いことに加え,材料 内部に形成される欠陥は転位ループなどのドット状欠陥が主であり、1x10²² H/m² という高い照射量まで キャビティなどの欠陥はほとんど形成されないことが知られている。そのため、3x10²² H/m²の照射量に おいても反射率の低下が発生しないことが考えられる。図 2 に 250nm、690nm、1050nm の波長におけ る 8.0kV·He⁺照射後による光反射率変化を示す。これより、それぞれの波長領域において R.T.~873K と 照射温度が高くなるにつれて反射率が低下していることが分かる。

図3に8.0keV-He⁺をR.T.、573K、873Kの試料温度で1x10²²及び3x10²² He/m²照射した場合の、 表面形状を観察したSEM像を示す。1x10²² He/m²照射では、室温、573K双方において直径100~200nm 程度のブリスターによる表面の凹凸が形成され、873Kではそれがさらに1000nm程度にまで成長して いるものが確認された。これに対し、3x10²² He/m²照射では、室温、573K、873K それぞれの照射にお いてブリスターは観察されなかった。これはスパッタリングによりブリスターを含む表面層の大部分が 除去されたことによって表面が平滑化したためと考えられる。しかしながら、このような表面の平滑化 が進行しているにもかかわらず、光反射率(R690)は低下している。これより、光学特性劣化はブリスタ ーによる表面凹凸の形成のみが原因ではないことが示唆される。

図4に反射率低下の著しい8.0keV-He⁺を873Kで1x10²² He/m² 照射した場合の内部断面組織を示す。 これより、He 照射後の表面直下領域には深さ分布~100nm にまで大量のヘリウムバブルが形成されポー ラス状の構造となっていることが確認された。さらに、表面直下の欠陥組織層の光学物性値 (n, k)を評 価した結果を図5に示す。照射温度の増加に伴って屈折率 n, 消衰係数kが共に変化していることが分 かる。これは、He⁺照射によって未照射 Mo が異なった物性状態へと変化していることを示唆している。 中でもkの低下が著しく、図3より表面直下はバブルによる疎な組織が形成されているため、Mo が光 を吸収しにくい物性状態へと変化したとも考えられる。

4. まとめ

本研究を通して、以下の知見を得ることができた。

(1)He⁺照射は、1x10²² [He/m²]程度の照射で顕著な反射率の劣化を招き,H⁺照射よりもはるかに照射効果が 大きい。 (2)光学特性劣化は、ブリスターによる表面凹凸の形成が主な原因ではなく、表面直下に形成されるヘリウム

(2)元字特性劣化は、フリスターによる表面凹凸の形成が主な原因ではなく、表面直下に形成されるヘリリュ バブルによるポーラス状欠陥組織が引き起こす物性的変化によるものであると考えられる。

5. 発表(投稿)論文

"Irradiation effects of low energy helium ions on optical reflectivity of metallic mirror", A. Ebihara, M. Tokitani, K. Tokunaga, T. Fujiwara, A. Sagara, N. Yoshida, J. Nucl. Mater. Vol.363-365(2007)1195-1200 "Retention properties of plasma particles in tungsten exposed to LHD divertor plasmas", M. Tokitani, M. Miyamoto, K. Tokunaga, T. Fujiwara, N. Yoshida, S. Masuzaki, N. Ashikawa, T. Morisaki, M. Shoji, A. Komori, S. Nagata and B. Tsuchiya, J. Nuclear. Mater. Vol. 363-365(2007)443-447



図 1 照射イオン種やイオンエネルギーの違いによる反射率変化



図 3 8.0keV-He+の照射量増加に伴う表面 変質と反射率



図 2 λ=250nm, 690nm, 1060nm の波長に 対する反射率の照射温度依存性



図 4 8.0keV-He+照射後の表面直下組織



モリブデンシリサイド基超高温耐酸化コーティング材料の開発

東北大環境科学研究科 吉見享祐、 北大・エネマテ 山内啓 黒川一哉

東北大·金研 後藤孝 塗溶

1. はじめに(1から5まで10ポイント)

エネルギー変換効率の向上は、地球環境保全の観点から環境負荷低減と省エネルギー化を促進し循環型社会 を実現するための最も重要な技術概念の一つである。とりわけ、発電やジェットエンジンなど大量エネルギー 消費とそれによる大量発熱を伴うエネルギー変換システムにおいては、Ni 基超合金の耐用温度を超えた温度 域で使用可能な超高温耐熱合金の開発が強く求められている。超高温耐熱合金はセラミックス材料系と同等の 融点でありながら、金属の属性である延性・展伸性を兼ね備えており、低温域での靭性や疲労特性に優れた材 料系である。Mo-Si 系合金の中には、MoSi2や MosSi3+B 合金など超高温下で耐酸化性に優れた組成が存在す る。本研究では、これら MoSi2 を基本組成とした耐酸化コーティング材の開発を念頭に置いて研究を行う。 MoSi2 は酸化することによって Mo 酸化物が昇華し、シリカ膜を形成する。シリカ膜は下地の Mo-Si 合金と熱 力学的に極めて安定で相平衡する。従って TGO(熱成長酸化物)の生成は無く、シリカ膜と MoSi2 皮膜は健全 な密着性と熱安定性を得られるためである。さらに、これら MoSi2 は、Mo/MosSiB2 in-situ 複合材料に対し て Si の化学ポテンシャルが小さいため、基板との間の反応性が低く、熱力学的にも安定である。この組み合 わせによって、Ni 基超合金の耐用温度を超える温度範囲(1400~1600℃)で、無冷却で使用可能なモリブデ ンシリサイド基超高温耐熱材料システムの新規デザインを行っていく。本報告では、基礎的なデータ収集を目 的として、B 添加 MoSi2 材に関する水蒸気含有雰囲気における酸化特性の評価を行った結果を示す。

2. 研究経過

SPS により作製した MoSi2 及び 2mol%B 添加焼結体について組織及び耐酸化性についての評価を行った。 これらの試料の組織観察・元素分析には走査型電子顕微鏡(SEM)と電子線マイクロアナライザー(EPMA)を用 いた。さらに、耐酸化性の評価を目的として、MoSi2 及び 2mol%B 添加 MoSi2 焼結体は、大気及び水蒸気含 有雰囲気((N2・3%O2)・19.7%H2O)下、773~1473 K で酸化試験を行った。酸化皮膜の表面及び元素分析に は電界放射型走査型電子顕微鏡(FE・SEM)と EPMA、表面生成物の同定には X 線回折法(XRD)を用いた。

3. 研究成果

水蒸気含有雰囲気においては、1273 K 以下の温度域に おいては、Mo 酸化物、ボロンおよびボロシリケートの蒸 発に起因する質量減少が酸化挙動に大きな影響を与えるこ とがわかった。それに対して、1473 K では物質の蒸発が 酸化挙動にほとんど影響せず、放物線則に従っていた。こ れは酸化初期から保護性を有する酸化皮膜が形成されてい たためと考えられる。また、これらの温度域で形成される 酸化皮膜は SiO2 主体であるが、ドーム状のボロシリケート の形成が確認された。水蒸気含有雰囲気において、なぜこ のような形状を示すかについては現在のところ明確にはな っていないが、局部的な B の濃化による粘性の低下とボロ シリケートが蒸発サイトとなることに依るものと推定され る。今後、皮膜の形成メカニズムなど不明な点を解明すべ く詳細な研究を進める予定である。



Fig.1 各温度、水蒸気含有雰囲気における B 添加 MoSi₂焼結体の質量変化

4. まとめ

MoSi2へのB添加は水蒸気含有雰囲気においても耐酸化 性の向上をもたらした。いずれの温度においても、ドーム状のボロシリケートを有するSiO2皮膜を形成した が、その皮膜形成メカニズムは不明である。

 発表(投稿)論文 現在のところなし(現在、投稿準備中)